

－SEAJ装置技術ロードマップ専門委員会－ 2008年度 リソグラフィー WG 活動報告 -1-

1. 定例会議

2009年度のロードマップ改訂に向けた準備として、リソグラフィーのポテンシャルソリューションに関する議論、各種学会・シンポジウムなどの参加報告、リソ関連講演会などを中心に、問題点の掘り下げ、検討を行なった。

2. 講演会

半導体・製造装置市場動向・予測手法検討とリソグラフィーの各種ソリューションの現状把握と課題検討を目的とした講演会を次のテーマと講師で開催した。

- ① 08年9月 「半導体・製造装置の市場動向と予測手法」 キヤノン 山田雄一様
- ② 11月 「マルチビームシステムの現状と課題」 東京エレクトロン 杉原和佳様
- ③ 11月 「EUVLの現状と今後の展望」 EUVA 笠間邦彦様
- ④ 09年2月 「DPTのレジストソリューション」 富士フイルム 樽谷晋司様
- ⑤ 2月 「フォトマスクの技術課題と展望」 凸版印刷 大瀧雅央様
- ⑥ 3月 「自己整合型DPTの開発動向と展望」 AMATジャパン 堀岡啓治様

リソグラフィ-WG活動報告 -2-

3. 会議・シンポジウムなど参加および報告

① STRJ定例会議

リソWGより特別委員4名が参加。会議の内容を定期的に報告

② ITRS国際会議(7月、サンフランシスコで開催)

SEAJ国際委員 山口がSTRJ特別委員として参加し、ロードマップに関し議論した。SEAJ Journal誌に参加報告書を投稿し掲載された。

③ 各種学会・シンポジウム参加・報告

各委員がフォトマスク・ジャパン(4月)、Litho Forum(5月)、EUVシンポジウム(9月)、ISTF(9月)、BACUS(10月)

SEMICONジャパン(12月)、EMLC(1月)、SPIE(2月)などに参加・情報収集を行い、定例会議で概要を適宜報告した。

4. 今後の課題

① リソグラフィのポテンシャルソリューションの最新の技術動向と課題解決に向けた開発状況の把握

② 製造装置への要求仕様の分析と解決方策の検討

③ 中期的な技術動向の予測精度向上